



ACADEMIC CAFÉ

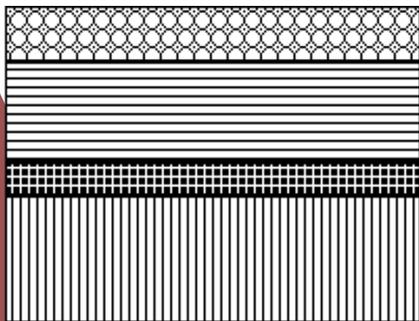
お茶とお菓子を
ご用意しています
お気軽にお越し
ください



第16回 AUEアカデミックカフェ

ものづくり やってみたいと 分からない!!!

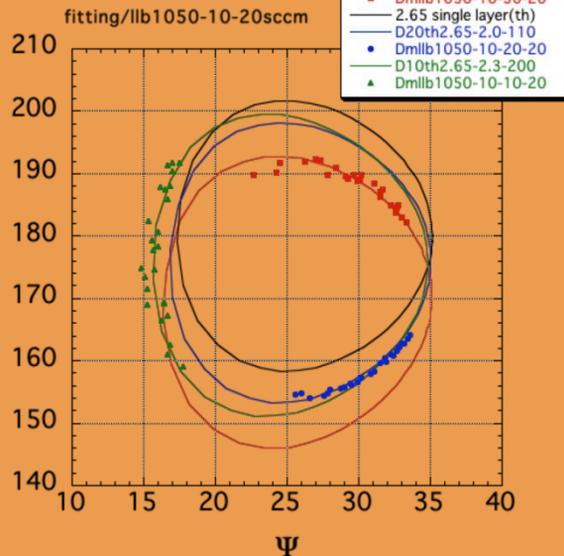
～半導体薄膜作製を通して～



Void/SiC surface layer
SiC homogeneous layer
SiC/Si interface layer
Si substrate

Three Layers Model

エリブソメトリ(偏光解析)による膜厚評価



理論曲線とのフィッティング例

参加無料・申込不要

〔講師〕 **清水秀己** (技術教育講座特別教授)

2月4日(月)

17:15~19:00

愛知教育大学
教育未来館3階
多目的ホール

講師プロフィール

1982年に愛知教育大学に採用され、2017年3月に定年をむかえ、現在、技術教育講座特別教授
専門は電気電子材料(半導体)工学
研究の主要テーマは、半導体薄膜材料の作製に関する研究

最近では、ワイドギャップ半導体である炭化硅素(SiC)薄膜ならびに酸化亜鉛(ZnO)薄膜を放電プラズマ利用による作製を行っている。

【問い合わせ先】

愛知教育大学 広報・地域連携課 ☎0566-26-2212
〒448-8542 刈谷市井ヶ谷町広沢1